科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成24年5月15日現在

機関番号:10101	
研究種目:基盤研究(A)	
研究期間:2009~2011	
課題番号:21241025	
研究課題名(和文)ナノ時空間ダイナミクスのその場観察法による物	₪質変換過程の解明
研究課題名(英义) Study of nano spatiotemporal dynamics on pr	nase transformation in
advanced materials by in situ observation technique	
研究代表者	
柴山 環樹 (TAMAKI SHIBAYAMA)	
北海道大学・大学院工学研究院・准教授	
研究者番号:10241564	

研究成果の概要(和文):本研究は、これまで透過電子顕微鏡で唯一の課題となっていた画像記録の高速化と長時間化についてピコ秒の現象であるレーザー核融合のターゲット計測に実績がある各種高速カメラを組み合わせたナノ時空間ダイナミクスその場観察システムの技術開発を行うことを目的として平成21年度から平成23年度まで3カ年計画で実施した。この新しく開発した装置を現有の透過電子顕微鏡に取り付けて、電子線やイオン照射下での接合界面における破壊の起点やマルチクラックの進展経路をこれまでは困難だったナノ時空間で記録しその場観察すると共に高速で発生し進展するマルチクラックとナノサイズ欠陥との相互作用を明らかにした。

研究成果の概要(英文):In this study, we carried out the development of in-situ observation experimental apparatus on nano spatiotemporal dynamics to combine the streak camera which had many successful results of the measurements in pico second phenomena on the laser inertial confinement fusion reaction at the target region of the fuel pellets and the various high speed CCD cameras in order to find out a solution of the only remaining issues to improve the temporal resolution and extend the recording time in TEM for three years from FY2009 to FY2011. We installed the newly developed experimental apparatus to our present TEM and investigate the crack initiation point or the multi crack propagation at the interface of the joint under electron irradiation and ion irradiation by recording in nano spatiotemporal resolution where so far it has not been done by us, and revealed the interaction between the multi crack paths which grew in high speed and nano sized defects.

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2009年度	18, 300, 000	5, 490, 000	23, 790, 000
2010年度	5, 000, 000	1, 500, 000	6, 500, 000
2011年度	4, 200, 000	1, 260, 000	5, 460, 000
年度			
年度			
総計	27, 500, 000	8, 250, 000	35, 750, 000

交付決定額

研究分野:複合新領域

科研費の分科・細目:ナノ・マイクロ科学 ・ ナノ材料・ナノバイオサイエンス キーワード:ナノ材料解析・評価、TEM

## 1. 研究開始当初の背景

透過電子顕微鏡(TEM)は、ナノメートルサ イズの結晶構造解析や元素分析が出来ること から材料科学では非常に有効な研究ツールで ある。更に、変形の様子や相変態の様子をTEM ホルダー内に応力印加機構や加熱機構を取り 付けることによって動的な現象をその場観察 できることから材料科学に多くの知見を提供 してきた。本研究を着想に至るまでは、既存 の高速度シャッター機構を備えたCCDカメラ と市販の30fpsのビデオレートの記録装置を 利用して破壊挙動のその場観察を行っていた。



図1 ミニチュアDNS型のTEM試験片を用いたSiC/SiC複 合材料のHVEM内破壊挙動その場観察、左の同期したTEM 像に、蛍光体の残光による虚像が見える。

図1に研究開発当初行っていたミニチュア DNS型のTEM試験片を用いたSiC/SiC複合材料 のTEM内破壊挙動その場観察の様子を示す。破 壊の挙動がTEMの蛍光体より速いことから残 光による虚像が記録されており本来の破壊に よるクラックの伝播挙動を観察することが出 来なかった。また、図2に示すように、アモ ルファスシリコンの薄膜をTEM内で等時焼鈍 を行い、結晶化を示す回折コントラストが観 察されたと同時に等温焼鈍に切り替え結晶化 の様子をその場観察したが、結晶化が起きる と同時にその結晶核の成長が非常に速いこと から核形成サイトを観察することは困難であ った。これらが明らかになれば半導体プロセ スに対して多くの知見を提供することが出来 ると考えられる。



図2 アモルファスシリコンの結晶化その場観察

しかしながら、クラックの起点や相変態の 核形成などのその場観察についてはこれまで 困難であった。そこで、国内外の関連する研 究の調査研究を行いグループ内で議論を進め てゆく中でストリークカメラとCCD カメラを 組み合わせて透過電子顕微鏡の画像記録の高 速化と長時間を実現するシステムを着想に至 った。

### 2. 研究の目的

本研究では、これまで透過電子顕微鏡で唯 ーの課題となっていた画像記録の高速化と長 時間化についてピコ秒の現象であるレーザー 核融合のターゲット計測に実績がある2次元 画像サンプリング方式のストリークカメラと CCD カメラを組み合わせたナノ時空間ダイナ ミクスその場観察システムの技術開発を行い、 これを現有の透過電子顕微鏡に取り付けて、 電子線やイオン照射下での接合界面における 破壊の起点やマルチクラックの進展経路をこ れまでは困難だったナノ時空間で記録しその 場観察すると共に高速で発生し進展するマル チクラックとナノサイズ欠陥との相互作用を 明らかにすることを目的とした。これによっ て得られた知見を材料製造プロセスにフィー ドバックすることにより新たな材料システム 開発へつながると共に高エネルギー量子ビー ムによる物質変換過程のごく初期の現象やそ の後の成長や組織化の素過程を捉えることが 初めて可能となる。

# 3. 研究の方法

これまでの画像記録システムでは電子線や 核変換による物質変換過程を模擬したイオン 照射下で材料が破壊に至る初期と最後を捉え ることは出来てもその素過程や多くのクラッ クが一度に発生するマルチクラックの進展は 捉えることが出来なかった。一方、本研究に 着手する当時、ドイツで開発されたパルスレ ーザーを金属ターゲットに照射し電子を発生 させ高周波で加速するフォトカソード電子源 に多くの研究者が注目し既存のTEMで使用さ れている安定な電子源を利用する応用研究は 我々が知る限りなかった。そこで、私たちは ピコ秒の現象であるレーザー核融合のターゲ ット計測に実績がある2次元画像サンプリン グ方式のストリークカメラとCCD カメラを組 み合わせたナノ時空間ダイナミクスその場観 察システムを着想するに至り本科学研究費補 助金を得て開発に成功した。本研究で開発し たナノ時空間ダイナミクスその場観察システ ムの模式図を図3示す。



図3 本研究で開発したテノ時空間タイナミクスその項 観察システムの模式図

これまで、透過電子顕微鏡の画像は、試料 を透過あるいは回折した電子を蛍光板に照射 し、その可視光領域の発光をCCD で連続記録 あるいはクラッシックな銀塩フィルムに記録 していた。そのため、蛍光体の残光や発光効 率により時間分解能を向上させることが難し かった。現有のTEMも、観察室の蛍光板を直接 観察あるいは撮影する方法、観察室下部のフ ィルムに撮影する方法あるいは観察室下部に 設けた蛍光スクリーンをCCDで撮影したり感 度を上げるためにイメージインテンシファイ ヤーを取り付けたりして改善していたことか ら、本研究で開発したナノ時空間ダイナミク スその場観察システムにより格段の向上が期 待できる。

本装置で重要な役割を担う蛍光体自身は、 テレビで使用されることが多いことからその 輝度や応答性を高めるための開発研究が盛ん であったが、最近多くのテレビがブラウン管 から液晶に移行したことから適当な蛍光体を 入手することが難しかった。そこで、共同研 究者の協力を得て輝度と減衰能が高い希土類 系のP46-Y3相当の蛍光体を入手し、図1に示 す「画像取り出しウインドウ」のTEM側に塗布 し、表面の帯電を防止するために数10nmのAl を真空蒸着した。可視光の減衰を極力低減す るために、可視光領域がゼロロスの光学ガラ スを用いた。この段階でも従来のmsecの時間 分解能に対して約0.1 μ secの分解能に向上す ることが期待できる。また、TEM像観察領域の 空間分解能を向上させるために、分担研究者 の弓削高専の伊藤准教授の円孔レンズアレイ を使用し、図4に示す円孔の数とサイズを考 慮して動作確認を行うと共にナノ時空間その 場観察システムの評価を実施した。





り期待される結晶のアモルファス化

次に、ストリークカメラの受光面にタンデ ム型のリレーレンズを設けて光電面に TEM 像 が写るようにした。その後、ストリークカメ ラ内の相引電極により相引時間に相当する時 間だけ下部の蛍光面に TEM 像が写りイメージ インテンシファイヤーで増感した後、CCD カ メラを通じて PC のハードディスクに記録し た。 TEM は、実像だけでなく結晶構造の情報 を含む電子回折図形を取得することが出来る。 そこで、本研究で開発したナノ時空間ダイナ ミクスその場観察システムを利用して電子回 折図形を取得する時間内に結晶のアモルファ ス化が生じたとすると図5に示すような電子 回折図形の取得が期待できる。

4. 研究成果

(1)ナノ時空間ダイナミクスその場観察システムの開発

図6に示すように、現有の熱電子銃を装着した 200keV の汎用型 TEM のカメラ室後段に本研究で開発したナノ時空間ダイナミクスその場観察システムを取り付けた。(赤い点線で囲んだ装置)既存の TEM に取り付けられるように、浜松フォトニクス株式会社の協力を得てストリーク管の長さを決めると共にリレ

ーレンズを用いることにより十分な倍率を得 られるように設計した。カメラ室底部に取り 付けた「画像取り出しウインドウ」での倍率 は本来のカメラ室の銀塩フィルム上での倍率 に対して 1.6 倍の拡大率であった。



図6 現有の TEM に取り付けたナノ時空間ダイナミクス その場観察システム

(2) ナノ時空間ダイナミクスその場観察シ ステムの評価(電子回折の場合)

本研究で開発したナノ時空間ダイナミクス その場観察システムの時間分解能を評価する ために、ストリーク管内のゲート電極を開放 する時間をパルスジェネレータで制御し、電 子回折図形のスポットを1回掃引してCCDに 記録された軌跡の長さをピクセル数で評価し た。100ns毎にゲートを開放する時間を変化 させ、それぞれ数回計測して評価した。その 例を図7に示す。黒化度が50%及び100%のピク セルを計測し、平均すると300nsに対して589 ピクセルであることが分かった、その結果、 CCDの縦方向のピクセル数1024が521nsに対応 することが明らかになった。



図7 ゲートオープン時間制御による時間分解能評価

(3) ナノ時空間ダイナミクスその場観察シ ステムの開発(明視野像の場合)

本装置を利用し、ゲートオープンの時間を 短縮させて、掃引電極を作動させなければシ ングルモードでCCDにTEM像を撮影することが 出来る。そこで、非晶質カーボン膜にInを真 空蒸着し、ビームヒーティングによる加熱に よる溶融並びにその後の急冷による結晶化の 過程を観察した結果を図8に示す。



### 図8 ゲートオープンショット明視野像

(a)は6msec、(b)は30msecである。現状では、 6msecが明視野像観察の最高時間分解能であ ることが分かった。今後は、本装置を利用し てナノ時空間ダイナミクス研究を発展的に継 続すると共に関連の研究者へも開放し材料科 学の研究発展に寄与すべく計画している。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

### 〔雑誌論文〕(計6件)

① H.Kawaguchi and <u>Y.Ito</u>, Numerical Analysis of Sampling Streak Camera for Higher Temporal Resolution Operation、IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS、査読有、2012、Vol48、411-414、

### 10.1109/TMAG.2011.2174343

② <u>Tamaki Shibayama</u>、Genichiro Matsuo、 Kouichi Hamada、<u>Seiichi Watanabe</u> and Hirotatsu Kishimoto、In-situ Observation of Fracture Behavior on Nano Structure in NITE SiC/SiC Composite by HVEM、IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering、 査読有、Vol. 18、2011、162013(1)-162013(4)、 doi:10.1088/1757-899X/18/16/162013

③Genichiro Matsuoa、<u>Tamaki Shibayama</u>、 Hirotatsu Kishimoto 、Kouichi Hamada 、 <u>Seiichi Watanabe</u>、Micro-chemical analysis of diffusion bonded W-SiC joint, Journal of Nuclear Materials、査読有、Vol. 417、2011、 391-394、

doi:10.1016/j.jnucmat.2011.02.005

④H. Kawaguchi、<u>Y. Ito</u>、Numerical Analysis of Sampling Streak Camera for Higher Temporal Resolution Operation、Proceedings of the 18th International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields (COMPUMAG 2011)、2011、July、Sydney、 Australia、査読有、2011、PC4.7.、DOI 無

⑤<u>Y. Ito</u>, H. Kawaguchi, T. Weiland, Numerical Analysis of the Amplification Process of the Micro Channel Plate (MCP) in the Framing Camera, Proceedings of the 18th International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields (COMPUMAG 2011), 2011, July, Sydney, Australia, 査読有, 2011, PC4.8., DOI 無

⑥川口秀樹、前田和憲、小舘翔平、<u>伊藤芳浩</u>、 ストリークカメラの空間電荷効果を考慮した 境界要素法解析に関する研究、電気学会電磁 界理論研究会 EMT-11-158、査読無、2011、 45-48、DOI 無

 〔学会発表〕(計11件)
①柴山環樹、谷津茂男、渡辺精一、伊藤芳浩、 富岡智、西山修輔、ナノ時空間ダイナミクスのその場観察法による物質変換過程の解明、
日本金属学会 2012 年春期講演大会、2012 年 3
月 28 日、横浜国立大学

② Meng Xua、 <u>Tamaki Shibayama</u>、 <u>Seiichi</u> <u>Watanabe</u>、他 2 名、Single layered Au cluster formation in TiO2 substrate by ion irradiation technique 、 International Symposium on Role of Electron Microscopy in Industry、2012 年 1 月 19 日、名古屋大学野 依記念学術交流会館

③Tamaki Shibayama、Seiichi Watanabe、他 〔図書〕(計0件) 1 名、In-situ observation of fracture behavior of nano structured composites in 〔産業財産権〕 HVEM, International Symposium on Role of ○出願状況(計1件) Electron Microscopy in Industry、2012 年1 月19日、名古屋大学野依記念学術交流会館 名称:ナノ粒子の製造方法及びナノ粒子分散 液 発明者:鳥本司、他3名、柴山環樹 ④柴山環樹、谷津茂男、渡辺精一、他4名、拡散接 合した SiC/SiC 複合材料と Wの接合界面の微細構造 権利者:鳥本司、他3名、柴山環樹 と接合強度、日本金属学会 2011 年秋期講演大会、 種類:特許 番号:出願中 2011年11月9日、沖縄コンベンションセンター 出願年月日: 平成 22 年 11 月 30 日 ⑤ <u>Tamaki Shibayama</u>, Genichiro Matsuo, 国内外の別:国内 Seiichi Watanabe、他 4 名、In-situ ○取得状況(計0件) measurements of interfacial shear strength SiC/SiC composites in HVEM . of International Conference on Fusion 名称: Reactoer Materials 15、2011 年 10 月 21 日、 発明者: Hilton Hotel, Charlston, U.S.A. 権利者 : 種類: 番号: ⑥<u>Tamaki Shibayama、Seiichi Watanabe</u>、他 3 名、In-situ Observation of Fracture 取得年月日: Behavior on Nani Structure in NITE SiC/SiC 国内外の別: Composite by HVEM 3<sup>rd</sup> International Congress on Ceramics (ICC3)、平成 22 年 10 [その他] 月16日、大阪国際会議場 ホームページ等 http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/ryosh ⑦柴山環樹、谷津茂男、渡辺精一、伊藤芳浩、 i\_carem/?page\_id=21 <u>富岡智、西山修輔</u>、ナノ時空間ダイナミクス のその場観察法による物質変換過程の解明、 6. 研究組織 日本顕微鏡学会、2011年5月17日、福岡国 (1)研究代表者 際会議場 柴山 環樹 (TAMAKI SHIBAYAMA) 北海道大学・大学院工学研究院・准教授 ⑧<u>柴山環樹、谷津茂男、渡辺精一</u>、他4名、 研究者番号:10241564 CVD-SiC のデュアルビーム照射効果、日本金 属学会 2010 年秋期講演大会、2010 年 9 月 27 (2)研究分担者 日、北海道大学 渡辺 精一 (SEIICHI WATANABE) 北海道大学・大学院工学研究院・教授 ⑨柴山環樹、渡辺精一、他3名、超高圧電子 研究者番号:60241353 顕微鏡による複合ナノ構造の破壊挙動その場 谷津 茂男 (SHIGEO YATSU) 北海道大学・大学院工学研究院・助教 観察、日本顕微鏡学会、2010 年 5 月 26 日、 名古屋国際会議場 研究者番号:40111158 伊藤 芳浩 (YOSHIHIRO ITOH) ⑩Tamaki Shibayama、Seiichi Watanabe、他 弓削商船高等専門学校・情報工学科・准教授 3 名、Development of In-situ Fracture 研究者番号:00435471 富岡 智 (SATOSHI TOMIOKA) Observation Technique with Load and Displacement Measurement in HVEM, The 北海道大学・大学院工学研究院・准教授 Twelfth Frontiers of Electron Microscopy 研究者番号:40237110 in Materials Science(FEMMS 2009)、2009年 西山 修輔 (SYUSUKE NISHIYAMA) 9月28日、ハウステンボス 北海道大学・大学院工学研究院・助教 研究者番号: 30333628 ⑪松尾元一郎、柴山環樹、渡辺精一、他4名、 W/SiC 接合界面に形成した反応相の微細構造 (3) 連携研究者 解析とクラック進展のその場観察(優秀ポス 坂口 紀史 (NORIHITO SAKAGUCHI) ター賞)、日本金属学会 2009 年秋期講演大会、 北海道大学・大学院工学研究院・准教授 2009年9月15日、京都大学 研究者番号:70344489 (H21)